

لایه نشانی لایه نازک نانوهیریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی متیل متاکریلات

مجتبی حاج فرجزاده، اکبر اسحاقی* و عباسعلی آقائی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

(دريافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷)

چکیده- لایه نازک نانوهیریدی ترا اتیل اورتوسیلیکات- تری گلیسیدوکسی پپروپیل تری متوكسی سیلان روی زیرلایه پلی متیل متاکریلات به روش سل- ژل غوطه‌وری اعمال شد. آزمون‌های پراش سنجی پرتو ایکس، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز با تکنیک بازتاب کلی تضعیف شده، میکروسکوپی الکترونی روپیشی گسیل میدانی و میکروسکوپی نیروی اتمی به ترتیب به منظور بررسی ساختار، پوندهای سطحی، مورفولوژی و زبری لایه نازک صورت گرفت. طیف‌سنجی نور مرئی- فرابنفش به منظور اندازه‌گیری طیف عبور نمونه‌ها انجام شد. همچنین چسبندگی و سختی پوشش به ترتیب توسط آزمون‌های نوار و مداد ارزیابی شد. نتایج حاصل از آنالیز پراش سنجی پرتو ایکس، تشکیل پوششی با ساختار آمورف را اثبات کرد. همچنین تصاویر میکروسکوپی الکترونی روپیشی گسیل میدانی مشخص کرد که با اضافه کردن GPTMS به سل TEOS فیلمی عاری از ترک ایجاد خواهد شد. همچنین بر اساس نتایج طیف‌سنجی نور مرئی- فرابنفش، اعمال لایه نازک نانوهیریدی افزایش میزان عبور را در ناحیه مرئی نسبت به زیرلایه پلی متیل متاکریلات به همراه خواهد داشت. در ضمن، آزمون مداد نشان داد که با اعمال لایه نازک نانوهیریدی روی زیرلایه پلیمری سختی از $3H$ به $6H$ افزایش می‌یابد. از طرفی آزمون نوار چسبندگی بالای لایه نازک نانوهیریدی را به زیرلایه پلی متیل متاکریلات اثبات کرد. درنتیجه پوشش شفاف هیریدی آلی- معدنی GPTMS-TEOS می‌تواند به عنوان پوشش ضدخش روی زیرلایه پلیمری پلی متیل متاکریلات استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: لایه نازک، هیرید، خواص اپتیکی، سختی، سل- ژل، پلی متیل متاکریلات.

Fabrication and Characterization of an Optical Nano-hybrid Sol-gel Derived Thin Film on the PMMA Substrate

M. Hajfarajzadeh, A. Eshaghi* and A. Aghaei

Department of Materials Engineering, Maleke Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran.

Abstract: A TEOS-GPTMS nano-hybrid thin film was deposited on the polymethyl methacrylate (PMMA) substrate by a sol-gel dip coating method. Morphology, roughness and surface chemical bonding of the thin films were evaluated by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy(FE-SEM), atomic force microscopy, and Fourier transform infrared spectroscopy methods, respectively. UV-vis spectrophotometer was used to measure the transmittance spectra of the samples. Also, the adhesion and hardness of the coatings were investigated using pencil hardness the adhesion tape test and the test, respectively. XRD results proved that the thin film had an amorphous structure. Also, FE-SEM images indicated that addition of GPTMS to the TEOS yielded a crack-free thin film. Based on the UV-vis spectroscopy results, the transmittance of the polymer substrate in the visible region was increased by the deposition of the nano-hybrid coating. Moreover, the hardness of the PMMA substrate was increased from $3H$ to $6H$ by the deposition of the nano-hybrid thin film. Also, tape test confirmed the high adhesion of the nano-hybrid thin film on the PMMA substrate. Consequently, the transparent organic-inorganic GPTMS-TEOS

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: eshaghi.akbar@gmail.com

hybrid coating can be used as a scratch resistant coating on the PMMA substrate.

Keywords: Thin Film, Hybrid, Optical properties, Hardness, Sol-gel, PMMA.

ایجاد می شود [۸ و ۹] که برای بر طرف کردن این عیوب و به دست آوردن خواصی جدیدتر امروزه تحقیقات در مورد شبکه های هیریدی آلی - غیرآلی که کاربردهای فراوانی دارند، متمرکز شده است. لذا اغلب پوشش های آلی - غیرآلی هیریدی برای اصلاح خواص سطحی از جمله مقاومت سایشی و به طور همزمان انعطاف پذیری مورد استفاده قرار می گیرد [۱۰]. این مواد مزایای مواد غیرآلی مثل مقاومت حرارتی بالا، خواص مکانیکی و اپتیکی مناسب را به همراه مزایای پلیمرهای آلی از جمله چرمگی، انعطاف پذیری و آسانی فرایند تولید را دارا هستند [۱۱ و ۱۲]. به تازگی پوشش های هیریدی آلی - غیرآلی توجه زیادی را در علم نانومواد به خود جلب کرده است. این مواد می توانند از طریق ترکیب همزمان پلیمرهای آلی و غیرآلی با استفاده از فرایند سل - ژل سنتر شود [۱۰ و ۱۳].

فناوری سل - ژل در سال های اخیر به علت مزایای مهمی که در ساخت پوشش های لایه نازک دارد اهمیت زیادی پیدا کرده است. از جمله مهم ترین این مزایا می توان به پایین بودن دمای فرایند (که تحت این شرایط تبخیر و تجزیه حرارتی کمتر می شود)، کم هزینه تر بودن این روش نسبت به سایر روش های مرسوم، تولید لایه نازک و امکان پوشش دهی اشکال پیچیده به جهت استفاده از پیش ماده های مایع و تولید لایه های نازک بدون نیاز به عملیات تکمیلی، ماشین کاری و ... اشاره کرد [۱۴ و ۱۵].

پلاستیک ها و پلیمرها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع اپتیکی پیدا کرده اند، در زمینه انواع پوشش های مطالعات زیادی روی آنها انجام گرفته است. اما در زمینه پوشش های اپتیکی مقاوم به خراش تحقیقات کمی صورت گرفته و هنوز خواص مکانیکی لازم را برای طیف گسترده ای از زیر لایه ها فراهم نکرده است. بنابراین توسعه پوشش های جایگزین پوشش هایی که به طور متداول روی زیر لایه های شیشه ای اعمال می شد، روی پلاستیک و پلیمرها نیز ضروری است. در این راستا یکی از دیدگاه های

۱- مقدمه

مواد پلیمری شفاف مانند پلی متیل متاکریلات به دلیل خواص بی نظیری مثل سبکی وزن، شفافیت اپتیکی، خواص الکتریکی و مکانیکی و آسانی تولید ابوه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. چنین موادی برای جایگزینی با مواد غیرآلی در محدوده وسیعی از کاربردها، شامل: صفحات نمایشگرها، دیسک های فشرده، لنزهای چشمی سبک و پنجره های محافظ مناسب هستند [۳-۱]. همچنین به دلیل تمايل صنایع موجود برای تولید قطعات الکترونیکی و فوتونیکی انعطاف پذیر، استفاده از مواد پلیمری مورد بررسی قرار گرفته است [۴]. مهم ترین پلیمرهای شفاف شامل پلی کربنات و پلی متیل متاکریلات هستند. پلی کربنات از مقاومت به ضربه بالا و پایداری بالای حرارتی برخوردار است و برای بسیاری از کاربردهای صنعتی از جمله ظروف پلاستیکی و قطعات نوری (اپتیکی) از جمله دیسک های فشرده، شیشه های نشکن، شیشه سبک عینک به کار می رود. دیگر پلیمر شفاف، پلی متیل متاکریلات است که میزان شفافیت، مقاومت به ضربه و مقاومت در برابر حرارت بالاتری نسبت به پلی کربنات دارد و کاربرد گسترده ای در قطعات اپتیکی از جمله چراغ اتومبیل، صفحه نمایشگرها و لنز عینک دارد [۵]. هر چند این مواد مقاومت به خراش و سایش کمی دارند و تخریب محیطی بالای آنها کاربردشان را محدود کرده است [۶ و ۷]. اعمال پوشش های غیرآلی به خصوص پوشش دهی اکسید فلزات روی پلیمر یکی از راه های غلبه بر این محدودیت ها است. استفاده از چنین پوشش های سرامیکی روی زیر لایه های پلیمری به منظور بهبود خواص مکانیکی، در سال های گذشته توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است. اما مشکلاتی از جمله انرژی سطحی کم و همچنین عدم وجود مکان های اتصال مناسب بر سطح پلیمرها سبب کاهش چسبندگی پوشش های سرامیکی و خواص مکانیکی ضعیف پوشش های می شود و همچنین در پوشش لایه نازک به دلیل ساختار ترد و سرامیکی این مواد، ترک

اورتوسیلیکات^۳ هر دو با خلوص بالاتر از ۹۹ درصد به عنوان پیش ماده و به ترتیب تشکیل دهنده جزء آلی و غیرآلی پوشش نانوهیریدی به کار رفت. بیس فنل آ^۴ با خلوص بالاتر از ۹۹ درصد به عنوان عامل ایجاد کننده اتصالات عرضی^۵ مورد استفاده قرار گرفت. اتانول^۶ با خلوص ۹۹/۹۹ درصد و اسید کلریدریک ۳۷ درصد به ترتیب به عنوان حلال و کاتالیزور استفاده شدند. تمامی مواد معرفی شده در بالا از کمپانی مرک تهیه شده و به طور مستقیم و بدون هیچ گونه پالایش و خالص سازی دیگری مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۱-۲- تهیه سل هیریدی آلی- غیرآلی

سل هیریدی TEOS-GPTMS به صورت زیر تهیه شد: اتانول (EtOH) به تدریج به TEOS حل شده درون آب دیونیزه اضافه شد و به مدت ۱۰ دقیقه و در دمای محیط تحت هم زدن با همزن شد و بعد از ۱۰ دقیقه دور بر دقیقه قرار گرفت. در مرحله مغناطیسی و با سرعت ۱۰۰۰ دور بر دقیقه GPTMS به مخلوط در حال هم زدن افزوده شد. بعد پیش ماده GPTMS به سل هیریدی نهایی با استفاده از اسید کلریدریک بین ۲-۳ pH مخلوط در حال هم زدن افزوده شد. تنظیم شد. محلول نهایی با در پوشی مناسب پوشانده و به مدت ۹۰ دقیقه به وسیله همزن مغناطیسی با سرعت ۱۰۰۰ دور بر دقیقه هم زده و برای مدت یک روز پیرسازی شد. پس از اتمام فرایند پیرسازی، بیس فنل آ (BPA) در چند مرحله و دقیقاً قبل از پوشش دهنده به عنوان عامل اتصالات عرضی حلقه های اپوکسی^۷ موجود در GPTMS به سل اضافه شد. نسبت مولی TEOS:GPTMS:EtOH:H₂O:BPA ۰/۶:۰/۳:۱:۳:۱ برابر با مورد استفاده قرار گرفت.

۲-۱-۳- آماده سازی زیر لایه و لایه نشانی لایه نازک

نمونه های پلیمری پلی متیل متاکریلات^۸ به شکل صفحاتی با ابعاد ۱۰×۱۰ میلی متر مربع برش داده شدند. سپس تمیز سازی نمونه ها به ترتیب توسط حمام های آلترا سونیک اتانول و آب مقطر صورت گرفت. بعد از آن برای آماده سازی نمونه ها و ارتقای چسبندگی لایه نازک نسبت به زیر لایه، نمونه ها به مدت سه ساعت در

به نسبت جدید اما بسیار قابل اعتماد، استفاده از پوشش های هیریدی سل - ژل است، چرا که به راحتی می توانند پوشش های عاری از ترک و ضخیم، در مقیاس میکرومتر تشکیل دهنند و نیازمند دمای پخت پایین تری در مقایسه با لایه های اکسیدی هستند. در پوشش های آلی - معدنی زمینه آلی مزایاهای خودش را همچون عبور دهنده نور و هدایت گری و ... دارا است و مواد معدنی خواص مطلوب الکترونیکی، اپتیکی، مغناطیسی و کاتالیستی را دارند که کامل کننده خواص مواد آلی خالص اند. تاکنون در این ۲۰۰۱ زمینه تحقیقات مختلفی صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۱ میلادی، محققان چینی موفق شدند لایه نازک هیریدی از ترکیبات تتراتیل اورتوسیلیکات (TEOS) و ۳ گلیسیدوکسی پروپیل تری متوكسی سیلان (GPTMS) و اکسید روی (ZnO) را روی زیر لایه ای از جنس پلی متیل متاکریلات اعمال کنند. این پوشش علاوه بر ارتقای مقاومت به خراش، توان جذب پرتو فرابنفش در محدوده ۲۰۰-۳۰۰ نانومتر را از خود نشان داد [۱۶]. در سال ۲۰۰۲ میلادی، چوو و همکاران [۱۷] موفق به تهیه لایه نازک هیریدی شفاف سیلیکا و متاکریلوکسی پروپیل تری اتوکسی سیلان^۱ با چسبندگی مناسب به روش سل - ژل شدند. در سال ۲۰۰۶ میلادی، سالدانا و همکاران [۱۸] موفق به اعمال لایه نازک هیریدی SiO₂-PMMA روی زیر لایه اکریلیکی شدند. در سال ۲۰۱۰ میلادی، محققان کره ای روی زیر لایه پلی اتیلن ترفتالات پوششی هیریدی از سیلیکا و متاکریلوکسی پروپیل تری اتوکسی سیلان اعمال کردند و پس از بهینه کردن مقادیر، ضمن اصلاح میکروساختار، موفق به ارتقای عبور دهی نور تا بالای ۹۰ درصد شدند [۱۹]. در این تحقیق به منظور دستیابی به پوششی با خواص شفافیت و سختی بالا، لایه نازک نانوهیریدی آلی - معدنی پلی متیل متاکریلات - سیلیکا (SiO₂-PMMA) به روش سل - ژل بر زیر لایه پلی متیل متاکریلات اعمال شد.

۲- مواد و روش تحقیق

۲-۱- مواد

تری - گلیسیدوکسیدی پیروپیل - تری متوكسی سیلان^۲ و تتراتیل

لایه نازک با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی^{۱۲} (AFM; DS95-200 Denmark, AC mode, Frequency 255 KHz) محاسبه شد. طیف عبور پلیمر خام و لایه نازک هیریدی بهوسیله (Shimadzu UV-3100) طیفسنج مادون قرمز- مرئی- فرابنفش به دست آمد. آزمون نوار به منظور تعیین کیفی چسبندگی پوشش به زیرلایه توسط دستگاه مدل 750 Sheen ساخت شرکت شین انگلستان مطابق با استاندارد ASTM D3359 انجام شد [۲۰] و سختی لایه‌های نازک اعمالی به کمک تست سختی مداد (ASTM D3363) [۲۴] ارزیابی شد.

۳- نتایج و بحث

شکل (۱) الگوهای پراش پرتو ایکس زیرلایه خام و پوشش هیریدی GPTMS-TEOS را نشان می‌دهد. وجود پیک‌های پهن در شکل (۱) نشان می‌دهد که پوشش هیریدی TEOS-GPTMS دارای ساختار آمورف هستند. افزایش ارتفاع پیک‌ها در طیف پوشش هیریدی در مقادیر ۲۰ برابر ۱۴ و ۳۵ درجه نسبت به پلیمر خالص می‌تواند به علت تشکیل ذرات کریستالی کوچک در پوشش هیریدی باشد [۲۲ و ۲۳].

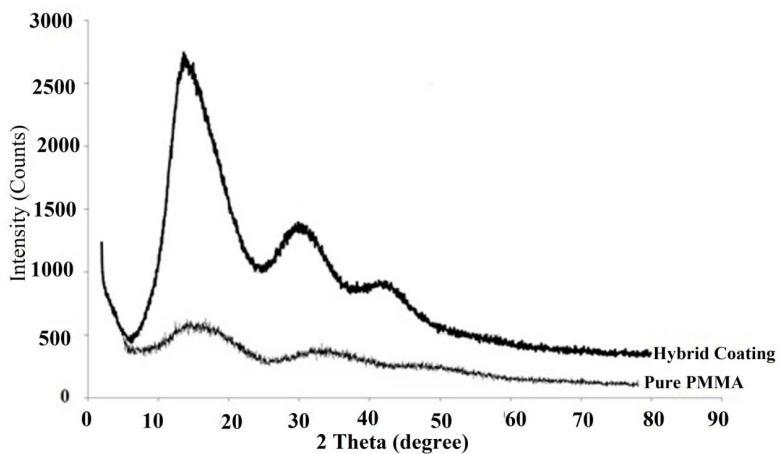
طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز با تکنیک بازتاب کلی تضعیف شده مربوط به لایه نازک هیریدی در شکل (۲) نشان داده شده است. جذب مشاهده شده در عدد موجی ۳۴۰۰ بر سانتی‌متر مختص ارتعاشات خمی پیوندهای O-H و مربوط به آب جذب شده روی سطح لایه نازک است [۲۴]. پیک جذبی در محدوده عدد موجی ۲۹۲۸-۲۷۰۰ برشانی متر به وجود گروه‌های آلی مثل CH₂ روی سطح اشاره می‌کند. همچنین جذب در محدوده عدد موجی ۱۶۱۰-۱۳۶۰ برشانی متر به حلقه اپوکسی موجود در GPTMS مربوط می‌شود. همچنین پیک جذبی ثبت شده در حدود عدد موجی ۱۰۵۰ برشانی متر ناشی از وجود پیوند Si-O-Si است. این پیوند تشکیل شبکه سیلوکسان را در طول فرایند پخت^{۱۳} نشان می‌دهد [۲۴].

شکل (۳) تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی گسیل

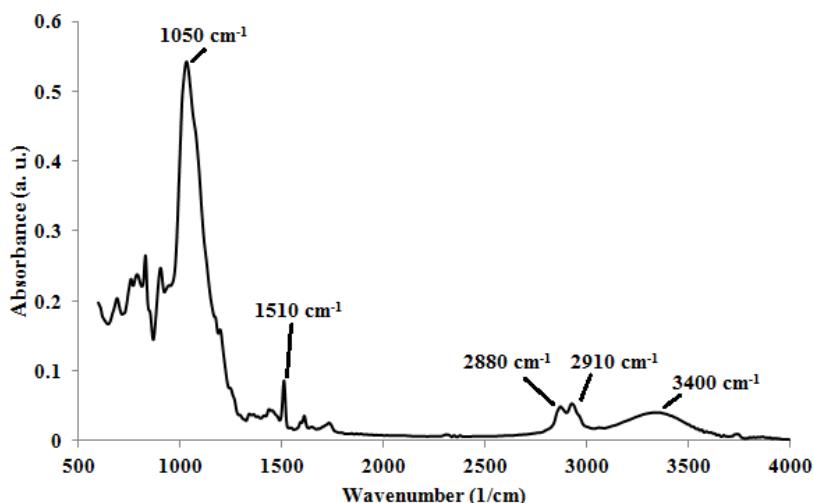
محلولی متشكل از TEOS:EtOH با نسبت مولی ۱:۱ و در دمای ۵۰-۶۰ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. درنهایت نمونه‌ها به منظور حذف محصولات اچ با اتانول و آب شستشو داده شده و به مدت ۳۰ دقیقه توسط آون با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد خشک شدند [۱۵]. در مرحله بعدی پوشش دهی نانوفیلم هیریدی به روش غوطه‌وری انجام شد. فرایند پوشش دهی با غوطه‌ور کردن نمونه‌های آماده‌سازی شده در سلی که ۴۸ ساعت پیرسازی شده بود، با سرعت بیرون کشیدن سه میلی‌متر بر ثانیه و زمان غوطه‌وری ۶۶ ثانیه انجام گرفت [۱۷]. سرعت بیرون کشیدن و زمان غوطه‌وری با بررسی سرعت‌های بیرون کشیدن گزارش شده در مقالات و نیز به کمک سعی و خطا در ساخت چندین نمونه به دست آمد. پس از پوشش دهی، نمونه‌ها ابتدا در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت خشک و سپس در دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت تحت عملیات پخت قرار داده شد.

۴- روش مشخصه‌یابی پوشش نانوهیریدی

به منظور مطالعه ساختار پوشش نانوهیریدی از پراش سنج پرتو ایکس^۹ فیلیپس مدل MPD ساخت شرکت هلند با شرایط منبع تابش Cu ka با طول موج ۱/۷۸۸ آنگستروم، ولتاژ ۴۰ کیلوولت، جریان ۳۰ میلی‌آمپر، زمان هر گام یک ثانیه و اندازه گام ۰/۰۲ استفاده شد. طیفسنج تبدیل فوریه مادون قرمز با تکنیک بازتاب کلی تضعیف شده ۱۰ ATR-FTIR; Bruker Germany, Tensor 27) تشخیص پیوندهای شیمیایی سطح لایه نازک هیریدی مورد استفاده قرار گرفت. طیف جذب سطح لایه نازک هیریدی در محدوده عدد موجی ۶۰۰۰-۴۰۰۰ برشانی متر با دقت ۱۶ بر سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. بررسی مورفولوژی سطح و آنالیز کیفی عنصری نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی^{۱۱} (FE-SEM, Hitachi S4160, cold field emission, voltage 20 kV) صورت گرفت. زیری سطح پلیمر خام و سطح



شکل ۱- الگوی پراش پرتو ایکس پوشش بهینه

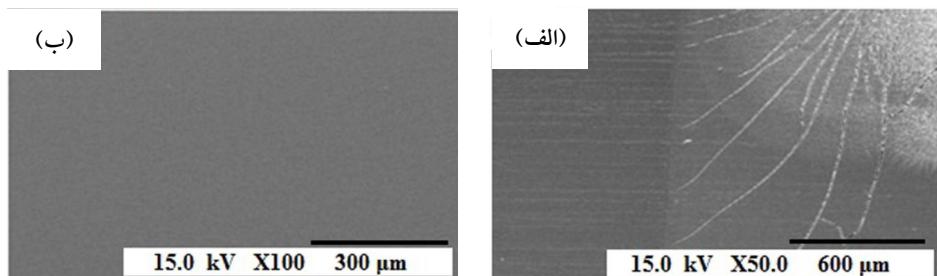


شکل ۲- طیف مادون قرمز با تبدیل فوریه با تکنیک بازتاب کلی تضعیف شده از پوشش هیریدی

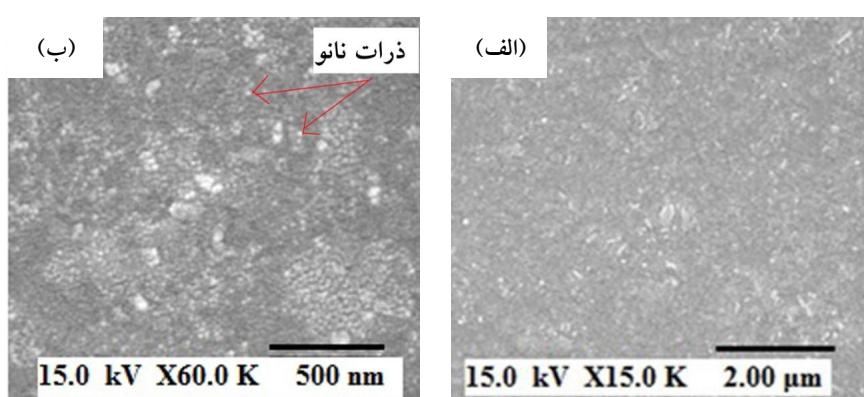
نسبت داد. انعطاف‌پذیری و چشمگی مکانیکی پوشش‌های هیریدی اثبات شده است [۶]. با افزودن GPTMS به TEOS و پوشش‌دهی لایه نازک هیریدی، تردی کاهش یافته و انعطاف‌پذیری پوشش بهبود یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این انعطاف‌پذیری مانع از ایجاد ترک در سطح لایه هیریدی اعمالی روی پلیمر در حین فرایند خشکسازی و پخت شده است.

در شکل (۴) تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی گسیل میدانی با بزرگنمایی $15000\times$ برابر و $60000\times$ برابر از سطح لایه

میدانی را از سطح لایه‌های نازک نانوهیریدی نشان می‌دهد. لایه نازک هیریدی تهیه شده از سل TEOS-GPTMS سطحی صاف و عاری از ترک را نشان می‌دهد درحالی که لایه نازک عمال شده از سل TEOS تنها، تشکیل یک سطح پر از ترک را روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات پس از فرایند خشک کردن نتیجه می‌دهد. افزودن GPTMS به TEOS یک پوشش بدون ترک را فراهم کرده که خواص فیزیکی مطلوبی دارد (شکل ۳-ب). لایه نازک حاصل از سل TEOS به روش سل-ژل رفتاری سرامیک دارد و لذا ایجاد ترک را می‌توان به تردی فیلم ایجادی



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی گسیل میدانی: (الف) فیلم ترا اتیل اورتوسیلیکات و (ب) فیلم نانوهیریدی

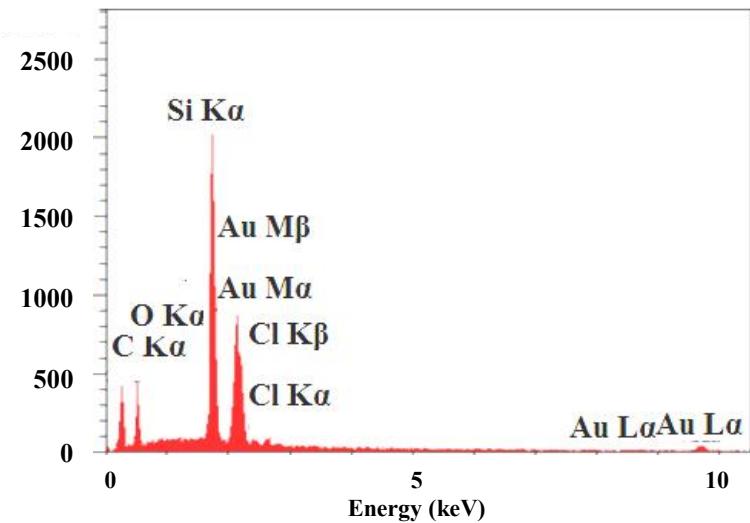


شکل ۴- تصاویر میکروسکوپی الکترونی رویشی گسیل میدانی با بزرگنمایی: (الف) ۱۵۰۰۰ برابر و
ب) ۶۰۰۰۰ برابر از فیلم نانوهیریدی

متاکریلات بدون پوشش و پوشش دهی شده به ترتیب برابر با ۵ و ۳ نانومتر به دست آمد. طبق نتایج میکروسکوپی نیروی اتمی، عامل لایه نانوهیریدی کاهش زیری سطح را به همراه دارد. طیف عبور زیرلایه پلی متیل متاکریلات بدون پوشش و دارای پوشش نانوهیریدی در محدوده طول موجی ۱۱۰۰-۲۰۰۰ نانومتر به دست آمد که در شکل (۷) نشان داده شده است. همان طور که در شکل (۷) مشاهده می شود، عامل لایه نازک نانوهیریدی بر سطح پلی متیل متاکریلات توانسته است میزان عبور را در ناحیه مرئی بهمود دهد. افزایش عبور در اثر کاهش زیری (همان طور که در شکل (۶) مشاهده شد) و لذا کاهش پراکنش است که با لایه نشانی لایه نازک نانوهیریدی بر سطح زیرلایه پلی متیل متاکریلات حاصل شده است [۲۶]. پوشش های اپتیکی باید از چسبندگی خوبی به زیرلایه برخوردار باشند، تا در اثر عوامل مختلف همچون تنفس های

نازک نانوهیریدی TEOS-GPTMS آمده است. مطابق شکل (۴) نانوذرات تشکیل شده در لایه نازک هیریدی مشخص است. ساختار شبه پلی سیلوکسانی از گروه های کوکسی و سیلانولی باقیمانده در فیلم ناشی می شود [۲۵] سطح لایه نازک نانوهیریدی اعمالی روی پلی متیل متاکریلات با استفاده از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس ۱۴ مورد آنالیز قرار گرفت. طیف مربوطه در شکل (۵) نشان داده شده است. در جدول (۱) نوع و درصد عناصر موجود در سطح لایه نازک نانوهیریدی آمده است.

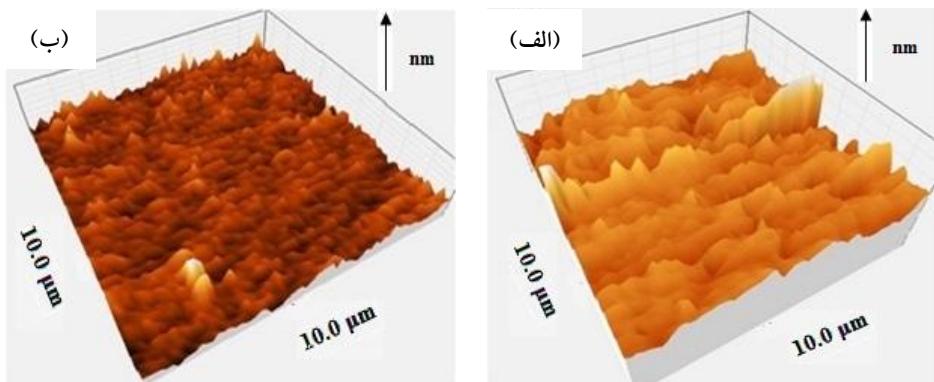
زیری سطح با استفاده از میکروسکوپی نیروی اتمی اندازه گیری شد. شکل (۶) تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی از سطح پلی متیل متاکریلات بدون پوشش و پلی متیل متاکریلات پوشش دهی شده با لایه نازک نانوهیریدی را نشان می دهد. مقادیر جذر میانگین مجذور (RMS) برای سطح پلی متیل



شکل ۵- الگوی پراش انرژی پرتو ایکس از سطح پلی متیل متاکریلات دارای پوشش نانوهیریدی

جدول ۱- نوع و درصد عناصر موجود بر روی سطح لایه نازک GPTMS/TEOS

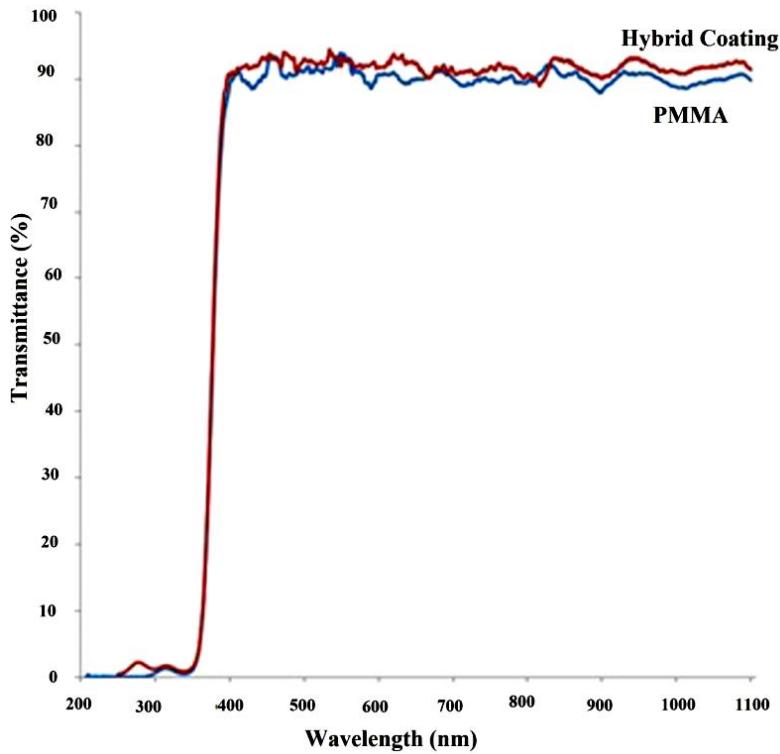
عنصر	خط	شدت (C/S)	غله‌ت (درصد وزنی)
C	Ka	۲۶/۳	۴۸/۶۹
O	Ka	۳۲/۶	۳۲/۱۹
Si	Ka	۱۸۷/۹	۱۸/۴۳
Cl	Ka	۴/۷	۰/۶۹



شکل ۶- تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی از: (الف) سطح پلی متیل متاکریلات بدون پوشش و (ب) دارای پوشش نانوهیریدی

3359-02 D استفاده شد. در این آزمون، برش X مانند در فیلم موجود روی زیرلایه ایجاد شده و سپس چسب استاندارد روی محل خراش‌ها چسبانده شده و با نهایت شتاب جدا می‌شود.

سطحی و اعوجاج‌ها از زیرلایه جدا نشوند. لذا به منظور بررسی کیفی چسبندگی پوشش نانوهیریدی روی زیرلایه پلی متیل متاکریلات از آزمون نوار کراس-کات و طبق استاندارد ASTM



شکل ۷- طیف عبور از پلی متیل متاکریلات بدون پوشش و دارای پوشش نانوهیریدی (رنگی در نسخه الکترونیکی)

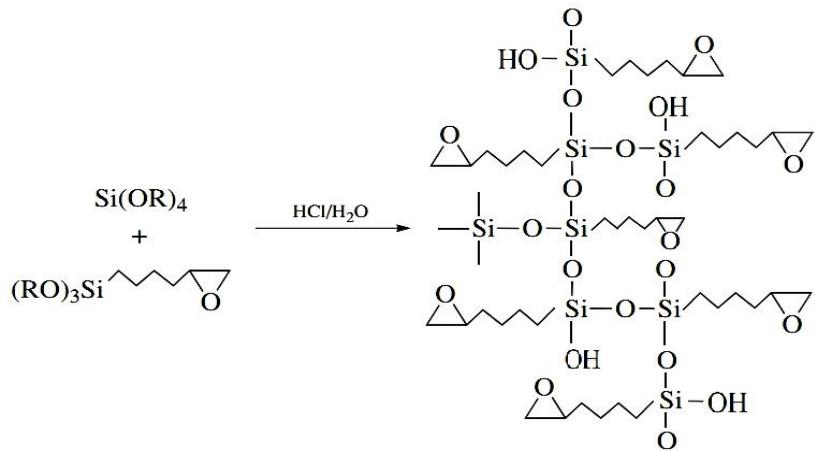
هیدرولیز- تراکم پیوندهای Si-O-Si را ایجاد کرده و در ادامه پیوندهای مستحکم پوشش از طریق تراکم سطحی تشکیل می شود. در حالی که شبکه های بهم پیوسته Si-O-Si تشکیل شده و گروه های هیدروکسیل سطحی وجود ندارند، دما امکان نفوذ بهتر سیلیکون الکتوکسید را به درون زمینه ماتریکس را به وجود می آورد [۱۷]. کیفیت چسبندگی برای پوشش حاصل شده بدون پیش عملیات برابر با ۳B (درصد جدا شدن پوشش برابر با ۵ تا الی ۱۵ درصد) ارزیابی شد.

آزمون سختی مداد به منظور ارزیابی سختی زیرلایه پلی متیل متاکریلات بدون پوشش و پوشش دهی شده مطابق با روش معروفی شده در استاندارد ASTM D3363 صورت گرفت. کیفیت سختی برابر $3H$ و $4H$ به ترتیب برای زیرلایه خام پلی متیل متاکریلات، زیرلایه دارای پوشش نانوهیریدی در غیاب بیس فنل آ و زیرلایه دارای پوشش نانوهیریدی با حضور بیس فنل آ به دست آمد. در فیلم نانوهیریدی جزء غیرآلی می تواند سختی را افزایش دهد [۵]. علاوه بر این حضور پایه

درصد جدا شدن پوشش که قابل بررسی با میکروسکوپ نوری است، کیفیت های چسبندگی میان B₀ تا 5B را تعریف می کند. کیفیت چسبندگی برای پوشش نانوهیریدی برابر با 5B (درصد جدا شدن پوشش برابر با صفر درصد) ارزیابی شد.

پژوهش هایی در گذشته نیز نشان داده که اعمال پوشش نانوسیلیکا/پلیمر روی زیرلایه پلی متیل متاکریلات چسبندگی برابر با 5B را ایجاد می کند. همچنین پوشش هیریدی GPTMS-SiO₂ اعمالی روی زیرلایه پلی کربنات چسبندگی برابر با 5B را نشان داده است [۶ و ۷].

در فیلم های نانوهیریدی اجزای آلی ترکیب پوشش می تواند چسبندگی بین لایه های نازک و زیرلایه های پلیمری را بهبود بخشد [۵]. در اثر پیش عملیات سطحی (قرار دادن نمونه در محلول TEOS-EtOH با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد)، آلكتوکسید سیلیکون نفوذ اولیه و نفوذ درونی به زیرلایه پلی متیل متاکریلات و لذا تشکیل شبکه های سیلیکا در هم نفوذی به درون زمینه پلیمر صورت می گیرد. علاوه بر آن واکنش های



شکل ۸- طرح واره واکنش تشکیل سیستم‌های هیبریدی آلی- غیرآلی (TEOS-GPTMS)؛ مراحل هیدرولیز و تراکم [۲۳]

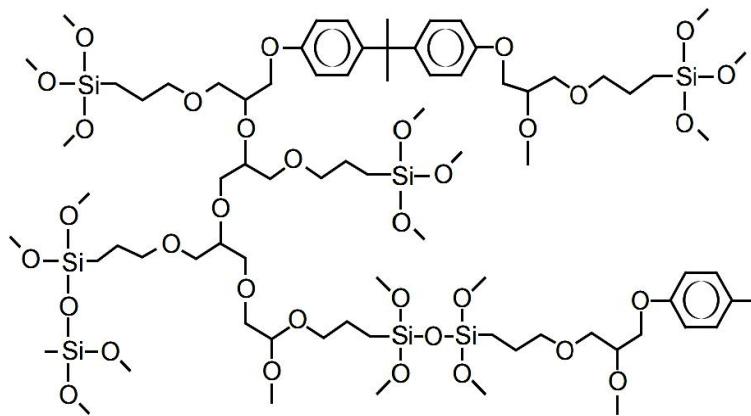
GPTMS در شکل (۸) نشان داده شده است [۲۸]. پایه فنل آب‌عنوان یک ماده اصلاح کننده سبب ایجاد اتصالات عرضی شده و ایجاد پوشش مستحکم‌تر و انعطاف‌پذیرتر را سبب می‌شود. این ماده فعالیت گروه‌های عاملی را افزایش می‌دهد که سبب می‌شود شبکه‌ای صلب با چگالی اتصالات عرضی بیشتر ایجاد شود [۲۸ و ۲۹]. با کاهش میزان بیس فنل آ، تعداد حلقه‌های اپوکسی در GPTMS افزایش می‌یابد که کاهش اتصالات عرضی بین شبکه سیلیکا و پایه فنل آ را به همراه دارد و لذا منجر به افزایش تردی و درنتیجه تشکیل ترک و نیز کاهش خواص مکانیکی، حرارتی و پایداری شیمیایی در پوشش هیبریدی می‌شود [۳۰]. در حضور یک کاتالیزور اسیدی، هیدروژن به اتم‌ها اکسیژن حلقه‌های اپوکسی حمله می‌کند و منجر به باز شدن حلقه اپوکسی در محیط اسیدی و تشکیل ساختار پلیمره می‌شود. مطابق با شکل (۹)، همزمان با باز شدن حلقه اپوکسی، عامل هیدروکسیل موجود در دو سر پایه فنل آ با حلقه باز شده اپوکسی واکنش می‌دهد و با ایجاد پیوندهای کووالانسی تشکیل شبکه‌ای از GPTMS و بیس فنل آ را می‌دهد [۳۰].

۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق پوشش نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات به روش سل-ژل غوطه‌وری اعمال

فنل آب‌عنوان عامل پخت و ایجاد کننده اتصالات عرضی گروه‌های اپوکسی موجود در GPTMS، افزایش سختی را نیز نتیجه می‌دهد [۲۷]. مطابق با نتایج تحقیقات پژوهشگران دیگر اعمال پوشش هیبریدی می‌تواند سختی و مقاومت به سایش زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات را افزایش دهد [۱۶]. انجام آزمون مداد روی نمونه پلی‌متیل متاکریلات بدون پوشش و نمونه پلی‌متیل متاکریلات آب‌گریز دارای پوشش نانوسیلیکا/پلیمر توانسته است میزان سختی را از ۳H تا ۷H بهبود بخشد. همچنین نتیجه آزمون مداد روی پلی‌کربنات خام و پلی‌کربنات دارای پوشش هیبریدی GPTMS-SiO₂ توانسته است میزان سختی را از مقدار H به ۷H افزایش دهد [۶ و ۷].

به دلیل حضور ترکیبات شیمیایی فرار و پیش‌ماده در محلول سل-ژل، دما در مراحل مختلف تشکیل لایه نازک نمی‌تواند از حد معینی افزایش یابد. این محدودیت در افزایش دما موجب کاهش چشمگیری در تحرک اجزای شبکه می‌شود. این مشکل می‌تواند با استفاده از کاتالیزور برطرف شود. محدوده pH بهینه برای هیدرولیز پیش‌ماده TEOS بین ۳ و ۵ است. به دلیل استفاده از کاتالیزور اسیدی در فرایند سل-ژل و نرخ بالای هیدرولیز پیش‌ماده‌ها در مقایسه با واکنش‌های تراکم، یک شبکه با ساختار منشعب با پیوند شبکه‌ای ضعیف تشکیل خواهد شد. طرح واره واکنش تشکیل سیستم‌های هیبریدی آلی- غیرآلی (TEOS-



[۲۹] طرح واره واکنش حلقه‌های اپوکسی BPA با GPTMS

اعمال پوشش نانوهیریدی TEOS-GPTMS در طول موج ۵۵۰ نانومتر از ۹۰/۱۵ درصد به مقدار ۹۲/۴۵ درصد افزایش یافت. پوشش دهی پوشش نانوهیریدی TEOS-GPTMS موجب افزایش سختی زیرلایه پلی متیل متاکریلات از مقدار ^{3}H به ^{6}H شد. همچنین میزان چسبندگی پوشش نانوهیریدی به زیرلایه پلی متیل متاکریلات برابر با ۵B اندازه‌گیری شد. مطالعه مورفولوژی سطح نشان داد که زیری سطحی در مقیاس نانومتری بوده که بر مقاومت به سایش موثر است. در مجموع می‌توان گفت که از این پوشش‌ها می‌توان به عنوان یک لایه اپتیکی ضد بازتاب، مقاوم به خراش و با چسبندگی بالا، در پلیمرهایی که جایگزین شیشه‌های اپتیکی شده‌اند استفاده کرد.

شد. آنالیز پراش‌سنجدی پرتو ایکس تشکیل پوشش نانوهیریدی TEOS-GPTMS با ساختاری آمورف را اثبات می‌کند. نتایج حاصل از آزمون‌های میکروسکوپی الکترونی روبشی حاکی از توزیع مناسب و هموژن مواد آلی و معدنی در پوشش نانوهیریدی است که از ایجاد ترک جلوگیری می‌کند. با توجه به آنالیز طیف‌سنجدی پراش انرژی پرتو ایکس حضور سیلیکون، کربن و اکسیژن در سطح لایه نازک نانوهیریدی اثبات شده است. این نتایج وجود پیوندهای سیلوکسانی که توسط آنالیز طیف‌سنجدی تبدیل فوریه مادون قرمز با تکنیک بازتاب کلی تضعیف شده اثبات شد را تأیید می‌کند. با توجه به نتایج طیف‌سنجدی نور مرئی میزان عبور زیرلایه پلی متیل متاکریلات با

واژه‌نامه

- 1. methacryloxypropyl trimethoxysilane
- 2. 3-Glycidoxypropyl-trimethoxysilane (GPTMS)
- 3. tetraethyl orthocarbonate (TEOS)
- 4. Bisphenol A (BPA)
- 5. cross-linking
- 6. ethanol (EtOH)
- 7. epoxy ring
- 8. poly methyl methacrylate (PMMA)
- 9. X-ray diffraction (XRD)
- 10. Attenuated Total Reflectance Fourier- Transform Infrared Spectrophotometer (ATR-FTIR)
- 11. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM)
- 12. Atomic Force Microscopy (AFM)
- 13. curing process
- 14. Energy Dispersive x-ray Spectroscopy (EDS)

مراجع

1. Wang, Y., Li, T., Li, S., and Sun, J., “Antifogging and Frost-Resisting Polyelectrolyte Coatings Capable of Healing Scratches and Restoring Transparency”, *Chemistry Materials*, Vol. 27, pp. 8058-8065, 2015.
2. Palavesam, N., Marin, S., Hemmetzberger, D., Landesberger, Ch., Bock, K., and Kutter, Ch., “Roll-to-roll Processing of Film Substrates for Hybrid Integrated Flexible Electronics”, *Flexible and*

- Printed Electronics*, Vol. 3, pp. 014002, 2018.
3. Liang, Ch. H., Chau, J. L. H., Pan, A. I. T., Yang, Ch. Ch., and Shih, H. H., "Development of Hybrid Amorphous Barrier Coatings on Polymer Substrates", *Journal of Materials: Design and Applications*, Vol. 230, pp. 569-573, 2016.
 4. Zhang, Y., Magan, J. J., and Blau, W. J., "A General Strategy for Hybrid Thin Film Fabrication and Transfer onto Arbitrary Substrates", *Nature*, pp. 1-5, 2014.
 5. Song, K. Ch., Park, J. K., Kang, H. U., and Kim, S. H., "Synthesis of Hydrophilic Coating Solution for Polymer Substrate using Glycidoxypropyltrimethoxysilane", *Journal of Sol-gel Science and Technology*, Vol. 27, No. 1, pp. 53-59, 2003.
 6. Wu, L. Y., Boon, L., Chen, Z., and Zeng, X. T., "Adhesion Enhancement of Sol-gel Coating on Polycarbonate by Heated Impregnation Treatment", *Thin Solid Films*, Vol. 517, pp. 4850-4856, 2009.
 7. Chang, C. C., Lin, Z. M., Huang, S. H., and Cheng, L. P., "Preparation of Highly Transparent 13F-Modified Nano-Silica/Polymer Hydrophobic Hard Coatings on Plastic Substrates", *Journal of Applied Science and Engineering*, Vol. 18, pp. 387-394, 2015.
 8. Wright, J. D., and Sommer, N., *Sol-gel Materials Chemistry and Applications*, CRC Press, New York, 2001.
 9. Wen, J., Wilkes, G. L., and Garth, L., "Organic/Inorganic Hybrid Network Materials by the Sol-gel Approach", *Chemistry of Materials*, Vol. 8, pp. 1667-1681, 1996.
 10. Figueira, R. B., Fontinha, I. R., Silva, C. J. R., and Pereira, E. V., "Hybrid Sol-gel Coatings: Smart and Green Materials for Corrosion Mitigation", *Coatings*, Vol. 6, pp. 1-19, 2016.
 11. Duo, S., Li, M., Zhu, M., and Zhou, Y., "Polydimethylsiloxane/silica Hybrid Coatings Protecting Kapton from Atomic Oxygen Attack", *Materials Chemistry and Physics*, Vol. 112, pp. 1093-1098, 2008.
 12. Adelkhani, H., Mellatnavaz, B., Roohi, H., and Noorbakhsh, M., "New Sol Gel Solution with 45 Days Stability for Preparation Silica Thin Films", *Iran Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, Vol. 26, pp. 25-29, 2007.
 13. Alvarado-Rivera, J., Munoz-Saldana, J., and Ramirez-Bon, R., "Nanoindentation Testing of SiO₂-PMMA Hybrid Films on Acrylic Substrates with Variable Coupling Agent Content", *Journal of Sol-gel Science and Technology*, Vol. 54, pp. 312-318, 2010.
 14. Maghzian, A., Monshi, A., and Fathi, M. H., "Synthesis and Characterization of Nano-structured CaTiO₃ Coating Via Sol-gel Dip-coating Route", *Journal of Advanced Materials in Engineering*, Vol. 29, No. 2, pp. 13-22, 2010.
 15. Letailleur, A. A., Ribot, F., Boissiere, C., Teisseire, J., Barthel, E., Desmazieres, B., Chemin, N., and Sanchez, C., "Sol Gel Derived Hybrid Thin Films: The Chemistry behind Processing", *Chemistry of Materials*, Vol. 23, pp. 5082-5089, 2011.
 16. Li, H., and Chen, Y., Preparation of Organic-inorganic Multifunctional Nanocomposite Coating via Sol-gel Routes", *Journal of Nanoparticle Research*, Vol. 3, pp. 157-160, 2001.
 17. Chou, T. P., and Cao, G., "Adhesion of Sol-gel Driven Organic-inorganic Hybrid Coatings on Polyester", *Journal of Sol-gel Science and Technology*, Vol. 27, pp. 31-41, 2003.
 18. Saldana, M., "Mechanical and thermal properties of SiO₂-PMMA monoliths", *Journal of Non-crystalline Solids*, Vol. 352, pp. 3561-3566, 2006.
 19. Kim, S. W., "Characterization of UV Curable Hybrid Coating Materials Prepared by Sol-gel", *Korean Journal of Chemical Engineering*, Vol. 28, pp. 298-303, 2011.
 20. ASTM D3359-02, *Standard Test Method For Measuring Adhesion by Tape Test*, Annual book of ASTM Standard, Vol. 0601, 2006.
 21. ASTM D3363-5, *Standard Test Method For Film Hardness by Pencil test*, Annual book of ASTM Standard, Vol. 0601, 2000.
 22. Donley, M. S., "The Self-assembled Nanophase Particle's Process: a Nanoscience Approach to Coating", *Progress in Organic Coatings*, Vol. 47, pp. 401-415, 2003.
 23. Daoud, W. A., Xin, J. H., and Tao, X., "Synthesis and Characterization of Hydrophobic Silica Nanocomposites", *Applied Surface Science*, Vol. 252, pp. 5368-5371, 2006.
 24. Zandi, R. Z., Verbeken, K., and Adriaens, A., "The Corrosion Resistance of 316L Stainless Steel Coated with a Silane Hybrid Nanocomposite Coating", *Progress in Organic Coating*, Vol. 72, p. 709, 2011.
 25. Foscant, R., Gysegem, A., Martinich, P. and Law, G., US Patent 4250074, 1981.
 26. Eshaghi, A., Pakshir, M., and Mozaffarinia, R., "Preparation and Photo-induced Superhydrophilicity of Composite TiO₂-SiO₂-In₂O₃ Thin Film", *Applied Surface Science*, Vol. 256, pp. 7062-7066, 2010.
 27. Innocenzi, P., Kidchob, T., and Yoko, T., "Hybrid Organic-inorganic Sol-gel Materials Based on Epoxy-Amine Systems", *Journal of Sol-gel Science and Technology*, Vol. 35, pp. 225-235, 2005.
 28. Matavos-Aramyan, S., "Preparation of Titania/Silica Core-Shell Hybrid Nanocomposites for 2024 Al-Alloy Corrosion Protection and Investigation of their Mechanical and Thermal Stability", *Silicon*, Vol. 10, pp. 1601-1612, 2018.

29. Pathak, S. S., Khanna, A. S., and Sinha, T. J. M., “Sol Gel Derived Organic-inorganic Hybrid Coating: a New Era in Corrosion Protection of Materials”, *Corrosion Reviews*, Vol. 24, pp. 281-306, 2006.
30. Zand, R. Z., Langrudi, A. E., and Rahimi, A., “Corrosion Resistance Performance of Cerium Doped Silica Sol-gel Coatings on 304L Stainless Steel”, *Iranian Polymer Journal*, Vol. 14, pp. 371-377, 2005.